

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成17年7月14日(2005.7.14)

【公表番号】特表2001-523987(P2001-523987A)

【公表日】平成13年11月27日(2001.11.27)

【出願番号】特願平10-521762

【国際特許分類第7版】

A 6 1 B 18/12

A 6 1 B 18/00

A 6 1 N 1/05

【F I】

A 6 1 B 17/39

A 6 1 N 1/05

A 6 1 B 17/36

【手続補正書】

【提出日】平成16年11月5日(2004.11.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】



手続補正書

平成16年11月5日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第521762号

2. 補正をする者

住所 アメリカ合衆国 カリフォルニア 95466, プレザントン,
コール センター パークウェイ 6900, スイート 417
名称 サークス, インコーポレイテッド

3. 代理人

住所 〒540-6015 大阪府大阪市中央区城見一丁目2番27号

クリスタルタワー15階

氏名 (7828) 弁理士 山本 秀策

電話 (大阪) 06-6949-3910



4. 補正対象書類名

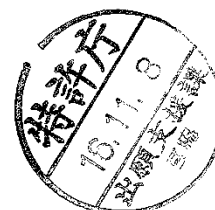
請求の範囲

5. 補正対象項目名

請求の範囲

6. 補正の内容

請求の範囲を別紙のとおり補正します。



請求の範囲

1. 筋膜を加熱するためのプローブであって、
近位端および遠位端を有するシャフトと、
該シャフトの該遠位端付近に配置される第1および第2の電極であって、該筋膜に対して同時に係合可能であり、且つ、組織加熱深度を制限する所定の距離だけ分離される第1および第2の電極と、
該シャフトの該近位端に隣接し、該電極を操作するためのハンドルと、を含む、
プローブ。
2. 前記ハンドルに装着される電池と、該電池に結合され、前記筋膜を加熱するためにRFエネルギーで前記電極を付勢するための回路と、をさらに含む、請求項1に記載のプローブ。
3. 前記電極の間に配置され、前記筋膜の温度を測定するためのセンサと、該電極および該センサに結合され、加熱された該筋膜の温度を約100℃よりも低い温度に制限するための制御システムと、をさらに含む、請求項1に記載のプローブ。
4. 電極表面直径が約0.25mmと約4mmとの間であり、前記分離距離が、該電極表面直径の約1倍と約4倍との間である、請求項1に記載のプローブ。
5. 前記第1および第2の電極が、前記筋膜の上を同時に掃引するために適合される、請求項4に記載のプローブ。
6. 前記第1および第2の電極のうちの少なくとも一方が、回転式エレメントを含む、請求項5に記載のプローブ。
7. 前記第1および第2の電極が、前記筋膜と隣接する組織層との間で狭い構成から広い構成まで展開可能であり、該電極は、該広い構成では、該筋膜に係合す

るように露出され、該電極は、該狭い構成では、該シャフトの軸に沿って配置され、該プローブの軸方向の挿入および退縮を容易にする、請求項1に記載のプローブ。

8. 前記シャフトに装着される展開式構造をさらに含み、該展開式構造は、前記電極が前記広い構成であるときには実質的に平坦な主表面を規定し、該展開式構造は、該主表面上の該電極を支持する、請求項7に記載のプローブ。

9. 前記展開式構造が、バルーンを含む、請求項8に記載のプローブ。

10. 標的組織を切除することなく該標的組織を加熱および萎縮させるために、十分なRF電力で前記電極を付勢する回路をさらに含む、請求項1に記載のプローブ。

11. 前記シャフトの前記遠位端付近に配置される把持装置であって、標的組織の領域内の引張りを低減するように該領域を内側に引き寄せるように適合される把持装置をさらに含む、請求項1に記載のプローブ。

12. 筋膜を加熱するためのプローブであって、

近位端および遠位端を有するシャフトと、

該シャフトの該遠位端付近に配置される第1および第2の二極電極であって、
該筋膜に対して同時に係合するために、約0.25mmと約4mmとの間の組織係合電極
表面直径を備える突出した丸い電極表面を有し、且つ、組織加熱深度を制限する
所定の距離だけ分離される、第1および第2の電極と、

該シャフトの該近位端に隣接し、該電極を操作するためのハンドルと、を含む、
プローブ。

13. 前記電極の間に配置され、前記筋膜の温度を測定するためのセンサと、該電
極および該センサに結合され、加熱された該筋膜の温度を約110℃よりも低い温
度に制限するための制御システムと、をさらに含む、請求項12に記載のプローブ。

14. 前記分離距離が、該電極表面直径の約1倍と約4倍との間である、請求項13に記載のプロープ。

15. 前記第1および第2の電極が、前記筋膜と、隣接する組織層との間で狭い構成から広い構成まで展開可能であり、該電極は、該広い構成では、該筋膜に係合するように露出され、該電極は、該狭い構成では、該シャフトの軸に沿って配置され、該プロープの軸方向の挿入および退縮を容易にし、ここで必要に応じて、該プロープは、該電極が前記広い構成であるときには実質的に平坦な主表面を規定する展開式構造をさらに含み、該展開式構造は、該主表面上の該電極を支持し、好ましくは、該展開式構造は、バルーンを含む、請求項12～14のいずれかに記載のプロープ。

16. 前記ハンドルは、電池、ならびに標的組織を実質的に切除することなく該標的組織を加熱および萎縮させるために十分なRF電力で付勢する回路をさらに含む、請求項1に記載のプロープ。

17. 前記シャフトの前記遠位端付近に配置される把持装置であって、標的組織の領域内の引張りを低減するように該領域を内側に引き寄せるように適合される把持装置をさらに含む、請求項12～14または16のいずれかに記載のプロープ。

18. 前記制御システムは、前記加熱された筋膜の温度を70℃～95℃に制限する、請求項14に記載のプロープ。

19. 前記電極に1ワット～20ワットのRFエネルギーを送達する電源をさらに含む、請求項1～18のいずれかに記載のプロープ。

20. 前記電源は、2ワット～5ワットのRFエネルギーを送達する、請求項19に記載のプロープ。

21. 前記第1および第2の電極は、前記筋膜の上を同時に掃引するために適合される、請求項15に記載のプロープ。

22. 前記第1および第2の電極のうちの少なくとも一方が、回転式エレメントを含む、請求項21に記載のプロープ。

23. 緩い骨盤支持構造を有する患者の腹圧性尿失禁を治療するためのシステムであって、

加熱素子を有するプロープと、

該プロープと結合可能な制御装置であって、該加熱素子を用いて該骨盤支持構造にある量のエネルギーを付与するように構成され、ここで該エネルギーの量は、該骨盤支持構造が尿失禁を阻害するようにするために十分である、制御装置と、を含む、システム。